

## عنوان مقاله:

توسعه یک مدل دو هدفه برای مسیله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

## محل انتشار:

فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 8، شماره 18 (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

## نویسندگان:

مهدی سیف برقی - استادیار دانشگاه الزهراء، دانشکده فنی و مهندسی

راضیه فرقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع دانشگاه الزهراء، دانشکده فنی و مهندسی

ظریفه راثی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع دانشگاه الزهراء، دانشکده فنی و مهندسی

## خلاصه مقاله:

مسیله مکان یابی حداکثر پوشش (MCLP) سعی در حداکثر نمودن پوشش جمعیتی می کند که در یک حداکثر فاصله با زمان مشخص از یک تجهیز قرار دارند. توسعه های بسیاری جهت بهبود کاربردهای این مسیله ارایه شده است که یکی از آنها ترکیب این مسیله با مدل های صف است. به عنوان مثال مکان یابی محل تعدادی خدمت دهنده با هدف حداکثر نمودن پوشش مشتریان و محدودیت در طول یا زمان انتظار مشتریان در صف. در این مقاله مدل ارایه شده توسط کورآ و لورنا [3] که به صورت یک مسیله حداکثر پوشش با محدودیت شاخص های صف است، توسعه داده می شود. بگونه ای که علاوه بر تابع هدف حداکثر پوشش، هدف حداقل نمودن فواصل خدمت دهنده ها تا مشتریان نیز در نظر گرفته می شود. بدین منظور بر خلاف مدل مقاله اصلی محدودیت خاصی در تخصیص مشتریان به گره های خدمت دهی ایجاد نگردیده و این خود مدل خواهد بود که نحوه تخصیص را مشخص می کند. مدل توسعه داده شده توسط الگوریتم ژنتیک و نرم افزار CPLEX حل و نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد مطلوب الگوریتم توسعه داده شده می باشد

## کلمات کلیدی:

مکان یابی، حداکثر پوشش، صف، الگوریتم ژنتیک، خدمت دهنده

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/720652>

